

# News Release



本資料は 2011 年 9 月 27 日に BASF 台湾で発表されたニュースリリースの和訳です。

2011 年 9 月 27 日

## BASF、半導体業界向けのプラントを台湾で新設

- ▶ CMP(化学機械研磨)スラリー・プラントに投資し、半導体業界で高まるニーズに対応
- ▶ 最先端の技術ノードに対応した独自製品ラインで既存プラントを代替

お問い合わせ:  
BASF ジャパン株式会社  
コーポレート・コミュニケーションズ本部  
麦谷 英理子  
TEL: 03-3796-4865  
FAX: 03-3796-4111  
eriko.mugitani@basf.com

BASF(本社:ドイツ ルートヴィヒスハーフェン)は、CMP(化学機械研磨)製品の製造プラントを台湾・桃園の観音坵点に新設し、運転を開始します。同プラントは、BASFが独自に開発したCMPスラリーを製造する設備で、2011年9月末には、最先端の半導体製造で使用されるCMPバリア・スラリー(PLANAPUR<sup>®</sup> Tシリーズ)とSTIスラリー(PLANAPUR<sup>®</sup> Sシリーズ)の生産を開始します。

この新設プラントは龍潭(ロンタン)にある既存のCMPスラリー製造プラントを代替し、BASF CMP事業の力強い成長を支えます。

BASF電子材料グローバル・ビジネス・ユニットのシニア・バイスプレジデント、ウルリヒ・ブシュゲスは次のように述べています。「当社の革新的なCMPスラリー製品は市場においても極めて優れたものとして高く評価されています。今回の投資は、生産能力を拡大するとともに製造効率を高め、顧客各社に対して、最先端のノード用に信頼される製品を安定的に供給するためのものであり、顧客のニーズに応えることに対する当社のゆるぎない姿勢を象徴するものです。」

BASF ジャパン株式会社  
コーポレート・コミュニケーションズ本部  
〒106-6121  
東京都港区六本木 6-10-1  
六本木ヒルズ森タワー21 階  
TEL: 03-3796-4865  
FAX: 03-3796-4111  
<http://www.japan.basf.com>

新設プラントは、BASFの電子材料事業の主力製造拠点である桃園に統合され、同社のCMP製品製造の中核をなすものとなります。この拠点には、CMPアプリケーション・ラボも設置しており、最先端ソリューションの開発、顧客との緊密な協力などを推進しています。

BASFでCMPのグローバル・ビジネス・マネージメントを統括するクレア・ワンは、次のように述べています。「アプリケーション・ラボと同じ拠点にCMP製品の製造プラントを新設することは、顧客と緊密な協力のもとで仕事を進め、重要な市場へのサービスを高めようという戦略構想にも合致します。これは、拡大しつつある先端材料の市場においてBASFのポジションを強化し、信頼性を明確に示すこととなります。」

BASFは、グローバルにおいても各地域においても、電子材料市場のリーダーであり、半導体製造各社とは25年以上の取引をおこなってきました。新しいプロセスの導入やノード・サイズの縮小に伴い、CMPプロセスには厳しい精度と平坦化機能が求められるようになっていきます。BASFのCMP製品は、いずれも、化学と半導体表面処理の分野でBASFの高度なノウハウに支えられています。CMPはいま、最先端のIC製造においてパフォーマンスを左右する重要な役割だと考えられています。

#### バリア・スラリー、PLANAPUR® Tシリーズについて

BASFの最先端銅バリアCMPスラリーは、ポリマーサイエンスや表面化学、材料化学に関してBASFが持つ革新的な技術とノウハウを結集したものです。優れた除去率と均一性を実現すると同時に欠陥を低減します。プロセスのニーズに合わせて選択性が調整できるので、トポグラフィーの補正を細かく行えます。

#### STI CMPスラリー、PLANAPUR® Sシリーズについて

BASFの堅牢なセリアとシリカのスラリーは、BASFが持つ化学関連のノウハウや特殊な研磨剤に関する知見を活用して開発したものです。粒子の安定

BASF ジャパン株式会社  
コーポレート・コミュニケーションズ本部  
〒106-6121  
東京都港区六本木 6-10-1  
六本木ヒルズ森タワー21 階  
TEL: 03-3796-4865  
FAX: 03-3796-4111  
<http://www.japan.basf.com>

性が高く、プロセス・ウィンドウを拡大してスループットの向上と欠陥の削減を実現します。



新しいプロセスの導入やノード・サイズの縮小に伴い、CMPプロセスにはいままで以上に厳しい精度と平坦化機能が求められるようになった。

#### ■BASF について

BASF(ビーエーエスエフ)は、「ザ・ケミカル・カンパニー(The Chemical Company)」を標榜する世界の化学業界のリーディングカンパニーです。製品ラインは、化学品、プラスチック製品、高機能製品、農業関連製品、ファインケミカル製品、石油・ガスと多岐にわたっています。BASFは信頼に応えるパートナー企業として、化学を通じあらゆる産業のお客様のさらなる成功を支援しています。また、高付加価値製品と高度なソリューションの提供により、気候保全やエネルギー効率の向上、栄養、交通・運搬環境の改善といった世界的な課題の解決に重要な役割を果たしています。2010年の売上は約639億ユーロで、従業員数は約10万9,000人です。BASFの詳細情報は、[www.basf.com](http://www.basf.com)(英語)、[newsroom.basf.com](http://newsroom.basf.com)(英語)、[www.japan.basf.com](http://www.japan.basf.com)(日本語)をご覧ください。

#### ■日本の BASF について

BASF は日本では 1888 年に事業を開始いたしました。国内では、BASF ジャパンと 7 社の関連会社で構成されています。事業活動は、化学品、プラスチック、機能性化学品、高機能製品、農業関連製品の 5 分野です。主要生産拠点は三重県四日市市(熱可塑性ポリウレタン、ポリマーディスパージョン)と、神奈川県茅ヶ崎市(コンクリート混和材、建設化学品)と横浜市戸塚区(塗料)です。尼崎研究開発センターでは、日本のお客様へのテクニカルサービスと、さらに先端技術産業のテクノロジーリーダーに近いという地理的利点を活かし、エレクトロニクス分野に特化した研究開発を行っています。特に「ディスプレイ」、「エナジーマネージメント」の分野にフォーカスし、日本発のイノベータータイプで、グローバルな製品の開発を目指しています。2010 年の BASF の日本での売上は 1,960 億円(16.9 億ユーロ)、従業員数は 1,700 人です。

BASF ジャパン株式会社  
コーポレート・コミュニケーションズ本部  
〒106-6121  
東京都区六本木 6-10-1  
六本木ヒルズ森タワー21 階  
TEL: 03-3796-4865  
FAX: 03-3796-4111  
<http://www.japan.basf.com>